



<b>(51) 国際特許分類6</b> <b>C07F 9/09, C09K 3/00, C08L 33/08, 33/10</b>	<b>A1</b>	<b>(11) 国際公開番号</b> <b>WO99/10354</b>  <b>(43) 国際公開日</b> <b>1999年3月4日(04.03.99)</b>
<b>(21) 国際出願番号</b> PCT/JP98/03757 <b>(22) 国際出願日</b> 1998年8月25日(25.08.98) <b>(30) 優先権データ</b> 特願平9/229723 1997年8月26日(26.08.97) JP 特願平9/229727 1997年8月26日(26.08.97) JP 特願平9/229731 1997年8月26日(26.08.97) JP <b>(71) 出願人 (米国を除くすべての指定国について)</b> 大八化学工業株式会社 (DAIHACHI CHEMICAL INDUSTRY CO., LTD.)[JP/JP] 〒577-0056 大阪府東大阪市長堂3丁目6-1 Osaka, (JP) 呉羽化学工業株式会社 (KUREHA KAGAKU KOGYO KABUSHIKI KAISHA)[JP/JP] 〒103-8552 東京都中央区日本橋堀留町1丁目9番11号 Tokyo, (JP) <b>(72) 発明者 ; および</b> <b>(75) 発明者 / 出願人 (米国についてののみ)</b> 大西康裕(OHNISHI, Yasuhiro)[JP/JP] 〒619-0237 京都府相楽郡精華町光台6丁目40-4-3 Kyoto, (JP)		上遠野浩樹(KATONO, Hiroki)[JP/JP] 〒974-8686 福島県いわき市錦町落合16 呉羽化学工業株式会社 錦工場内 Fukushima, (JP) <b>(74) 代理人</b> 弁理士 大井正彦(OHI, Masahiko) 〒101-0052 東京都千代田区神田小川町三丁目6番地1 栄信ビル Tokyo, (JP) <b>(81) 指定国</b> JP, US, 欧州特許 (AT, BE, CH, CY, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR, IE, IT, LU, MC, NL, PT, SE). 添付公開書類 国際調査報告書
<b>(54) Title: PHOSPHORIC ESTER COMPOUNDS AND PROCESS FOR PRODUCING THE SAME, COPPER PHOSPHORIC ESTER COMPOUNDS AND PROCESS FOR PRODUCING THE SAME, NEAR INFRARED ABSORBER, AND NEAR INFRARED ABSORBENT ACRYLIC RESIN COMPOSITION</b> <b>(54) 発明の名称</b> 燐酸エステル化合物およびその製造方法、燐酸エステル銅化合物およびその製造方法、近赤外線吸収剤並びに近赤外線吸収性アクリル系樹脂組成物 <div style="text-align: center; margin: 20px 0;"> <math display="block">\text{O} = \text{P} \begin{cases} (\text{OH})_n \\ (\text{OR})_{3-n} \end{cases} \quad (1)</math> </div> <b>(57) Abstract</b> New phosphoric ester compounds of general formula (1) and a process for producing the same; copper phosphoric ester compounds obtained from the phosphoric ester compounds and a process for producing the same; and a near infrared absorbent acrylic resin composition containing the copper phosphoric ester compound and being excellent in visible radiation permeability, capable of highly efficiently absorbing near infrared rays and reduced in the lowering of near infrared absorbency caused by the ultraviolet rays, wherein R is alkyl bonded to alkylene oxide having 1 to 6 repeating units, and n is 1 or 2.		